

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】平成19年11月1日(2007.11.1)

【公開番号】特開2005-226156(P2005-226156A)

【公開日】平成17年8月25日(2005.8.25)

【年通号数】公開・登録公報2005-033

【出願番号】特願2004-271466(P2004-271466)

【国際特許分類】

C 25 D 3/56 (2006.01)

C 25 D 5/50 (2006.01)

G 11 B 5/64 (2006.01)

G 11 B 5/858 (2006.01)

【F I】

C 25 D 3/56 F

C 25 D 5/50

G 11 B 5/64

G 11 B 5/858

【手続補正書】

【提出日】平成19年9月18日(2007.9.18)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

少なくとも、Feイオン、Ptイオン、錯化剤を含み、前記Feイオン濃度と前記Ptイオン濃度のモル比(Fe/Pt)が0.75 Fe/Pt 3であることを特徴とするめっき液。

【請求項2】

前記錯化剤が、酒石酸又はクエン酸のいずれかである請求項1記載のめっき液。

【請求項3】

前記Feイオン濃度が、0.005mol/L以上で0.1mol/L以下である請求項1又は2のいずれか記載のめっき液。

【請求項4】

前記めっき液のpHが、5.0以上10.5以下である請求項1から3のいずれか記載のめっき液。

【請求項5】

前記Feイオンと前記PtイオンがFe錯体及びPt錯体の複錯体を形成している請求項1から4のいずれか記載のめっき液。

【請求項6】

前記めっき液にCuを含むことを特徴とする請求項1から5のいずれか記載のめっき液。

【請求項7】

構造体の製造方法であって、

請求項1から6のいずれか記載のめっき液がはいっためっき浴に電極とめっきされる基板とを用意する工程と、

前記電極に電圧を印加することによって、めっき液からFePtを含む磁性体を前記基

板にめっきし、構造体を形成する工程とを備える構造体の製造方法。

【請求項 8】

請求項 7 記載の構造体をさらに、450 以上 750 以下で熱処理を行うことを特徴とする構造体の製造方法。

【請求項 9】

請求項 7 記載の構造体をさらに、水素存在下で熱処理を行うことを特徴とする構造体の製造方法。

【請求項 10】

前記めっきされる基板が、複数の穴を有する構造体であり、前記基板にめっきをし、構造体を形成する工程が、前記穴の中に Fe Pt を含む磁性体をめっきし、構造体を形成する工程である請求項 7 から 9 のいずれか記載の構造体の製造方法。

【請求項 11】

請求項 1 から 5 のいずれか記載のめっき液と前記めっき液を入れるめっき浴と電極とを備え、前記電極に電圧を印加することによりめっきを行うことを特徴とする装置。